

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第3区分

【発行日】平成29年1月26日(2017.1.26)

【公開番号】特開2013-40767(P2013-40767A)

【公開日】平成25年2月28日(2013.2.28)

【年通号数】公開・登録公報2013-010

【出願番号】特願2012-248149(P2012-248149)

【国際特許分類】

F 24 C 15/10 (2006.01)

F 24 C 15/00 (2006.01)

H 05 B 6/12 (2006.01)

【F I】

F 24 C 15/10 B

F 24 C 15/00 M

H 05 B 6/12 3 1 2

H 05 B 6/12 3 0 5

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年12月7日(2016.12.7)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0010

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0010】

一般に、上記領域の1つ（または以下に詳しく説明する領域群）が背景領域と呼ばれる領域を構成し、コーティングの表面の大半（一般に50～99%）を占めていて、好ましくはプレートが覆わねばならない加熱要素の重要部を隠すことを目的としている。他方の領域（または背景領域と対照的な他方の領域群）は、信号領域と呼ばれる領域であることが好ましく、背景領域との対照で、装飾、および／または表示（商標、ロゴ、シンボルなど）、および／または機能要素の位置（例えば加熱要素、制御装置、表示板など）を目立たせることができる。この領域により、これらの要素が作動中であるかないかを検出することもできる（この後者の領域で覆われた表面は、一般に、コーティングの表面の1～50%である）。今後は、領域という用語は（プレート上に存在しているそれぞれのカテゴリーの領域の数によるが）、はっきりと区画された単一の領域（この領域がそのカテゴリーの中の唯一のものである場合）だけでなく、（領域相互の間、または領域群相互の間に求められるコントラストとの関係で）同じカテゴリーの複数の区画された領域が存在している場合に同じように覆われている領域群、または同じ効果を有する領域群も意味するものとする。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0039

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0039】

反射層は、一般に、セラミック化した後のプレートに（例えばそのプレートを切断および／または加工した後）、一回で、または繰り返して付着させることができる。反射層は、特に、熱分解によって（粉末、液体、気体の場合）、または蒸着によって、またはスパッタリングによって付着させることができる。反射層は、スパッタリングおよび／または

真空蒸着法および／またはプラズマ支援法によって堆積させることが好ましい。その中でも、特に磁場（と直流または交流）を利用した陰極スパッタリング（例えばマグнетロン陰極スパッタリング）による層の堆積法が利用される。酸化物または窒化物は、必要な場合には酸化環境または窒化環境（必要な場合にはアルゴン／酸素混合物、またはアルゴン／窒素混合物）のもとで、金属、合金、シリカ、セラミックなどからなる適切なターゲットから堆積される。例えば酸化物層は酸素の存在下にて、窒化物は窒素の存在下にて、問題の金属の反応性スパッタリングによって堆積させることができる。 $\text{SiO}_2$  または  $\text{Si}_3\text{N}_4$  にするには、十分に導電性にするためアルミニウムなどの金属をわずかにドープしたシリカからなるターゲットから出発するとよい。本発明で選択した（下）層は基板の表面に非常に一様に凝縮し、分離や剥離は起こらない。

#### 【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0057

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0057】

例えば本発明の方法の好ましい一実施態様によれば、例えばセリグラフィによって（1回または数回の操作により、すなわち1つまたは複数の下層として、エナメルなしの部分を設けつつ）塗料の第1の層、その中でもすでに挙げた（無光沢の）塗料の層を付着させ、次いでその塗料を熱処理または焼成処理し、必要に応じてプレートを洗浄した後、第2の層（または（下）層群）を付着させ、すでに覆われている領域とエナメルなしの部分の全体を、陰極スパッタリング（マグネットロン陰極スパッタリングの場合には、プレート全体への堆積が実際にはより容易である）により、鏡面効果を有する少なくとも1つの反射層で覆う。

#### 【誤訳訂正4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0059

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0059】

本発明は、上に規定したガラスセラミック製プレートを製造するため、セリグラフィによる少なくとも1つのコーティング装置と、少なくとも1つの陰極スパッタリング装置とを備える装置も目的とする。

#### 【誤訳訂正5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0067

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0067】

塗料で覆われたこのプレートを必要に応じて洗浄した後、すでに塗料で覆われているこのプレートの下面全体に、例えばNi-Cr-Fe（それぞれの比率は例えば約68%/22%/10%である）をベースとした反射層を、マグネットロン陰極スパッタリングにより、（この層において、消えた状態の表示を隠すことと、その表示が点灯しているときにはっきりと見えることをうまくバランスさせることができる）約22.5nmの厚さに堆積させる。非常に細かいこの反射層による鏡面効果は、塗料層内に設けたエナメルなしの部分の位置にしか及ばず、ガラスセラミックが透明であるためにプレートの上方から見える背景領域の不透明な無光沢の灰色の外観にマイナスの効果が及ぶことはない。

#### 【誤訳訂正6】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

調理プレートとして使用するためのガラスセラミック製プレートであって、少なくとも 2 つの対照的な領域、すなわち背景領域および信号領域、を有するコーティングを備え、上記背景領域は、コーティングの表面積の 50 ~ 99 % を占め、プレートが覆わねばならない加熱要素の大部分をマスクし、

上記信号領域は、コーティングの表面積の 1 ~ 50 % を占め、そしてこの領域における該プレートの部分の光透過率を 0.2 ~ 20 % とし、

前記コーティングが前記領域を形成するように堆積された少なくとも 2 つの層であって、一方は前記背景領域だけを覆う層、他方は少なくとも前記信号領域を覆う層、により形成されており、該信号領域を覆う層は陰極スパッタリングにより堆積された反射層であり、

上記背景領域を覆う層は、塗料層であり、該層の塗料は、350 よりも高い分解温度を持ち、少なくとも 1 種類のシリコーン樹脂をベースとしている、

ことを特徴とするガラスセラミック製プレート。

【請求項 2】

透明または半透明なガラスセラミックをベースとしていること、及び、

上記コーティングが、その下層にある停止中の要素の少なくとも一部を隠すが、加熱要素と、信号領域にある表示板が作動中はそれらを確認できるようにすること、  
を特徴とする請求項 1 に記載のガラスセラミック製プレート。

【請求項 3】

対照的な複数の領域を有する上記コーティングが、主としてプレートの唯一の同一の面上に存在していて、その面は、使用位置にある加熱要素の方に向けられている、ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のガラスセラミック製プレート。

【請求項 4】

上記 2 つの対照的な領域は、少なくとも 1 つの無光沢領域と、少なくとも 1 つの反射領域である、ことを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載のガラスセラミック製プレート。

【請求項 5】

上記 2 つの対照的な領域が、厚さの異なるコーティングからなる領域である、ことを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載のガラスセラミック製プレート。

【請求項 6】

前記塗料が、少なくとも 1 種類の無機添加剤を含有している、ことを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載のガラスセラミック製プレート。

【請求項 7】

上記反射層が、鏡面効果またはキラキラ光る効果を有する層であり、

金属タイプの少なくとも 1 つの層、および / または誘電性材料をベースとした少なくとも 1 つの層で形成されているか、または、効果をもたらす顔料を含んだ、溶融シリカ、フリット、融解ガラスのいずれかで形成されている、

ことを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載のガラスセラミック製プレート。

。

【請求項 8】

下にある加熱要素と協働するようにされており、該加熱要素が誘導加熱要素である、ことを特徴とする、請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載のガラスセラミック製プレート。

【請求項 9】

請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載のプレートを製造する方法であって、

裸のガラスセラミック製プレートの 1 つの面に、背景領域に対応する少なくとも 1 つの第 1 の領域を形成する少なくとも 1 つの第 1 の層を付着させ、

該第1の層に1つまたは複数の除外部を用意するか設け、  
該除外部を、第1の領域とは対照的な、信号領域に対応する少なくとも1つの第2の領域を形成する少なくとも1つの第2の層で覆う、  
ことを特徴とする方法。

【請求項10】

請求項1から8のいずれか1項に記載のガラスセラミック製プレートと、1つまたは複数の加熱要素とを備え、該加熱要素が誘導加熱要素である、ことを特徴とする調理装置および／または高温維持装置。

【請求項11】

請求項1から8のいずれか1項に記載のガラスセラミック製プレートを製造するための装置であって、

少なくとも1つのスクリーン印刷によるコーティング装置と、少なくとも1つの陰極スパッタリング装置とを備える、ことを特徴とする装置。